

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Innovativity To Productivity

PRODUCTIVE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

普達特科技有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：650)

半導體設備業務發展的進展

本公告由普達特科技有限公司*(「本公司」)自願作出，以向本公司股東及有意投資者提供有關本公司最新業務發展的資料。

茲提述本公司日期為二零二六年三月二十四日的公告(「該公告」)，內容有關半導體設備業務的發展情況。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

獲得多台正式設備購買訂單

隨著本公司各類半導體設備平台持續交付客戶與通過驗證，本公司已積累大量的量產經驗並獲得行業認可，從而使本公司具備了取得更大批量正式訂單的有利條件。自該公告日期起，本公司共取得了29台新設備訂單，其中14台為半導體設備新訂單，包含單片清洗設備與爐管LPCVD設備。該等設備系統主要應用於客戶的高端特色工藝半導體與第三代半導體產線，覆蓋晶圓前後段工藝應用按機台數從多到少依次為：

- 1) OCTOPUS與OCTOPUS-SP單片清洗設備，用於12寸晶圓背面清洗、Solvent清洗、RCA清洗等工藝，其中含四台硫酸清洗設備；

* 僅供識別

2) CUBE單片清洗設備，用於背面清洗與刻蝕工藝；及

3) 爐管LPCVD設備，用於12寸SiN薄膜沉積工藝。

該等設備訂單均為正式訂單，暫未確認收入。本公司將在客戶通過驗證後確認收入。

據董事會經做出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，該等客戶及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

本公司自主研發的半導體清洗與爐管LPCVD/ALD設備平台，均可覆蓋成熟制程與先進邏輯、存儲制程，擁有對標國際領先設備廠商的技術性能與行業領先的設備生產力。其中，半導體清洗設備系列平台，以單片清洗設備為核心平台，覆蓋Solvent清洗、晶圓背面清洗、RCA清洗等行業主流濕法清洗應用。同時，本公司進一步突破技術壁壘，開發了190℃先進高溫硫酸清洗設備並成功出貨。本公司的半導體爐管設備平台，擁有LPCVD與ALD兩大先進設備產品線，針對12英寸晶圓SiN、Poly、TEOS等關鍵薄膜沉積工藝。此外，本公司已完成開發應用於14/7nm節點高性能介質層薄膜沉積的Low-K ALD SiOCN爐管設備，該細分領域目前仍由海外設備商壟斷。

未來，本公司將繼續發揮技術優勢，積極拓展市場，以期獲取更多批量化正式訂單並導入更多行業頭部客戶，以推動其半導體設備業務快速增長，並提升業務毛利率，促進本公司的持續有機發展。

一般事項

上述新訂單項下擬進行的交易並無構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章項下本公司的須予公佈交易。本公司將適時另行刊發公告(如需)。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
普達特科技有限公司*
主席兼首席執行官
劉二壯

香港，二零二六年十月十一日

本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名為執行董事，即劉二壯博士(主席)、譚嶠先生及劉知海先生；兩名為非執行董事，即曹霄輝先生及林鈺凱先生；及三名為獨立非執行董事，即葛艾繼女士、周承炎先生及王國平先生。